

سنتر و مطالعه پلی (۴،۴'-اکسی بیس فنیلن پیرو ملیتیمید) و چند مونومر آن

Synthesis and Study of Poly(4,4'-oxybisphenylene pyromellitimide) and Some of Its Monomers

فاطمه هیر خلیلزاده^۱، مسعود تقی گنجی^۲، محمود محرب زاده^۲

۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ۳۶ تهران، پژوهشگاه پلیمر ایران، صندوق پستی ۱۶۹۶۵-۱۱۵

۲- دویاپات: ۷۸/۹/۲۲، پذیرش: ۷۸/۱۱/۲۶

چکیده

نرکیب سیار معروفی از پلی ایمیدها به نام پلی (۴،۴'-اکسی بیس فنیلن پیرو ملیتیمید) به عنوان داشتن مقاومت گرمایی زیاد و خواص الکتریکی و مکانیکی منار مورد توجه فرازگره است. پلیمر شدن خطی گامی دو مرحله‌ای روش ساخت این نرکیب است. از واکنش ۴،۴'-اکسی دی آئین بن با پیرو ملیتیمید دی ایدرید در حللاهای غلظی می‌بردند و تقطیر دی میل قرامید، پلی آمیک اسید، این پلیمر با وزن مولکولی زیاد بدست می‌آید. پلیمر محلول از طریق یخت گرمایی به پلی ایمید آرومایک غیر محلول تبدیل می‌شود. پایداری گرمایی و اکسید شوندگی به وسیله سنتم تلفی TG-DSC ارزیابی شد و به کمک روش‌های طیف منجعی FT-H NMR و FTIR سنتز این پلیمر تأیید شد. در حین سنتز موثرهای برای تهیه ۴،۴'-اکسی دی آئین اند از نرکیب موتوپترودار آن یعنی پارائیزودی فلیل اثر نهیه شد. واکنش از مترودار کردن کلروبنزن شروع و محصول پس از حد اسارتی با پنایم فلوکسبید در محاورت کاتالیزور من فعال شده نرکیب شد. پس از تقطیر در خلا، پارائیزودی فلیل اثر با بازده ۷۸ درصد بدست آمد. سنتز موثرهای ۴،۴'-اکسی دی آئین دو استخلافی میزان ترجیحاً متازایلن آغاز و به وسیله کلرومتیل دار کردن محصول ۴ استخلافی ۶۰٪ پس (کلرومتیل) متازایلن با بازده ۶۶ درصد به اتحام رسید. اکاسیس محصول به کمک پلیمریک ایمید غلیظ و پنایم پر منگفات اتحام و پرسی گردید. طبقهای FTIR، FT-H NMR و خصوصیات مواد استرشده را انسان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: پلی (۴،۴'-اکسی بیس فنیلن پیرو ملیتیمید)، ۴،۴'-اکسی دی آئین، پلی ایمید ایمید، سنتز

Key Words: poly(4,4'-oxybisphenylene pyromellitimide), 4,4'-oxydianiline, pyromellitic dianhydride, polyamic acid, synthesis

رسیده است. این مواد به صورت فیلم، پودرهای قالبگیری، پوشش سیمها، چوب و رزین و در مصارف اختصاصی نر و پیشرفت‌های تر به صورت الیاف و اسفنج تولید می‌شوند. از میان پلی ایمیدها آرومایک پلی (۴،۴'-اکسی دی فنیلن پیرو ملیتیمید)، PI، معروف به کاپتون H به دلیل پایداری گرمایی، استحکام مکانیکی و مقاومت نسبت به تاثیر، مقاومت در برابر شعله و سایش و خاصیت دی الکتریکی خوب یکی، از مهمترین پلی ایمیدهای آرومایک [۲،۳] است. این پلیمر از

ساخت پلی ایمیدهای آرومایک نوسط شرکت دویان از حدود سال ۱۹۶۰ آغاز شده است. پایداری گرمایی [۱] و اکسید شوندگی این دسسه از پلیمرها موجب گسترش روزافرون مطالعات، تحقیقات و در نهایت تولید این پلیمرها شده است. بطوری که در ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۰ مقاله و نتیج اختراع درباره پلی ایمیدهای آرومایک به جا ب

در نتیجه بازده واکنش کم می شود [۳۲].
 ۳- نیترودار کردن کلروپترن و تشکیل کلروپترنون و واکنش
 محصول با پتاسیم فوکسید و نیترودار کردن مجدد آن ابعادلات ۸ و
 ۹. در این پژوهش از روش آخیر استفاده شده است [۳۲].
 هدف از این پژوهش مروری بر ستر این پلیمر و بررسی
 پایداری گرمایی و تیهیه مونومرهای ارزشمند آن از مواد اولیه
 ارزان قیمت است. مثلا، ODA و PMDA به عنوان مواد پایه در صنعت
 چسب، رنگ و رزین کاربرد دارند. به علاوه، از ۶،۴-بیس
 (کلرومتیل) متازایلن به همراه PMA و در تراکم با سدیم تفتالاتها به
 عنوان نرم کننده استفاده می شود [۲۴، ۲۵]. پلی نیترو دی تریل اترها
 هم برای بهبود خواص گرمایی مهابی چون سلولوز استرها، پلی و بیل
 رزینها و رزینهای متیل متاکریلات کاربرد دارند [۲۶].

تجزیی

مواد

PMDA با درجه خلوص ۹۵ درصد و ODA یا بیس (۶-آمینوفیل) اتر
 با درجه خلوص ۹۸ درصد از شرکت فلوكا و DMF خشک با درجه
 خلوص ۹۰ درصد از شرکت مرک تیهیه شد. خشک کردن شامل این
 مراحل است: نگهداری در کلسیم هیدرید به مدت ۲۴ ساعت، رفلاکس به
 مدت ۱ ساعت، تقطیر در خلاء و نگهداری روی الک مولکولی ۴۸.
 متازایلن با درجه خلوص ۹۸-۹۹ درصد، کلریدریک اسید غلیظ
 ۳۷ درصد، سولفوریک اسید غلیظ ۹۸ درصد و کلروپترن ۹۹ درصد
 از شرکت مرک تیهیه و محلول فرمالدهید ۲۳-۳۷ درصد، اسید نیترویک
 غلیظ ۶۳ درصد صنعتی و پر منگنات پتاسیم مرک مصرف شدند.

دستگاهها

از دستگاههای طیف سنجی زیر قرمز (IR) مدل ۹۷۱۲ PU و زیر قرمز
 انتقال فوریه (FTIR) مدل IPS۴۸ برکر، طیف سنج رزو نانس مغناطیسی
 هسته پروتون FT-H NMR (۲۰۰ MHz) (۳۰۰) ساخت بروکر و امپکترو اسپین
 و دستگاه گرماسنجی پویشی تفاضلی - تجزیه گرمایزنی (DSC-TGA) از کاهش
 مدل ۶۲۵ STA ساخت Rheometric Scientific استفاده شد.

روشها

سنتر پلی آمیک اسید

در یک بالن ۳ دهانه با ورودی نیتروزون و مجهز به لوله خشک کن
 حاوی کلسیم کلرید و همزن مکائیکی، مقدار مشخصی ODA در
 ۵ mL حلال DMF خشک حل می شود. سپس، تدریجاً مقداری هم از

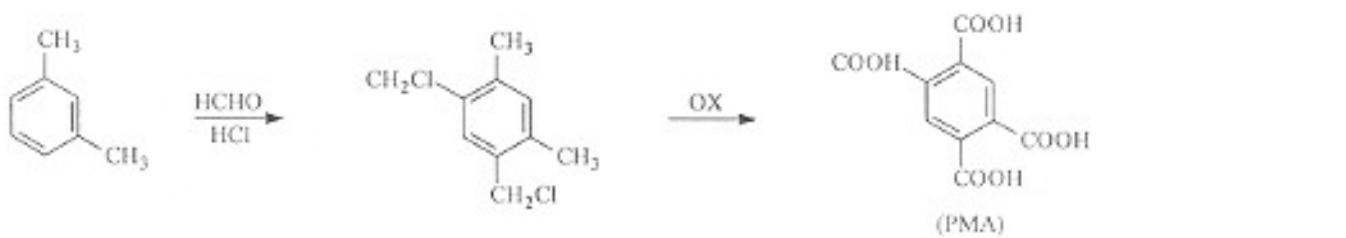
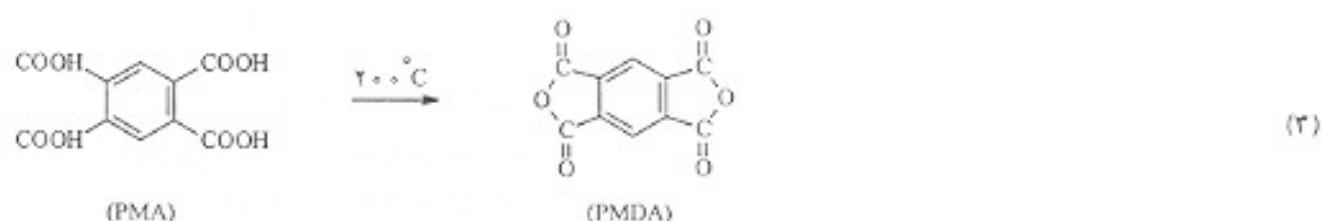
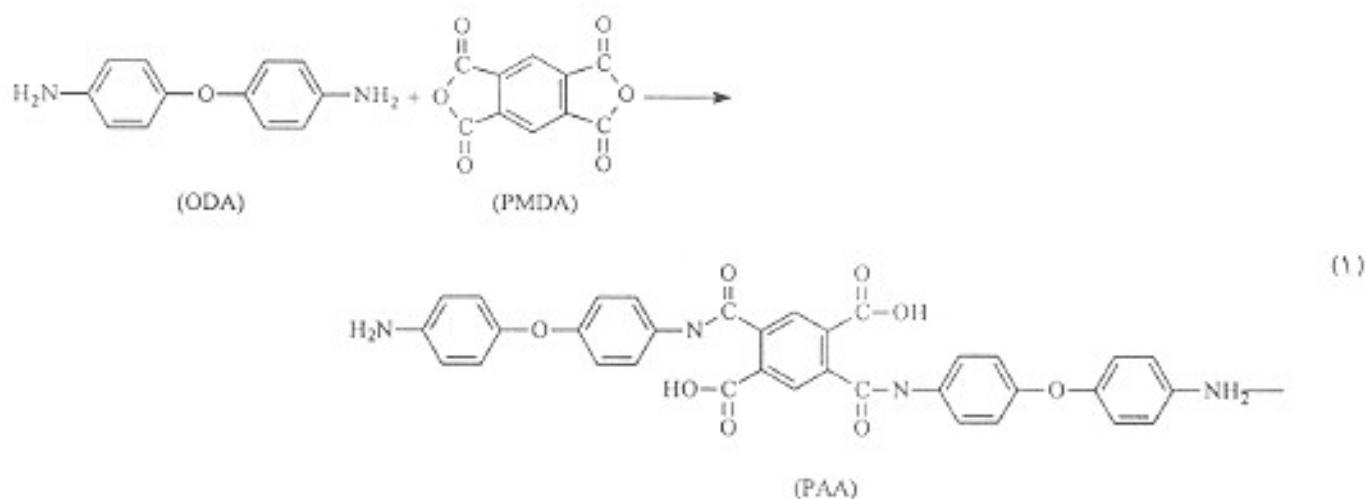
دسته پلیمرهای گرمایزم است و از حلالهای بی پروتون قطبی نظری
 دی متیل فرمامید (DMF)، N-متیل پیرویدون (NMP)، دی متیل استامید
 (DMAc) و دی متیل سولفوکسید (DMSO) و نظری آن برای پلیمر شدن
 و حل کردن پلی آمیک اسید (PAA) استفاده می شود. PAA از واکنش
 پیروملیتیمید دی اپندرید (PMDA) با ۴،۴'-اکسی دی آبیلن (ODA)
 در این حلالها (معادله ۱) بدست می آید [۴-۸] و پس با گرمایدن تا
 ۰°C پخت و تبدیل به پلی اپندرید می شود (معادله ۲). از PI برای لایه
 داخلی دی الکتریکها در تیهیه رسانهای [۹]، پوشش سیمهای [۱۰]، غشای
 حد اکننده گاز [۱۱]، پوشش متون کروماتوگرافی [۱۲] استفاده می شود.
 تاکنون مطالعات گسترده ای در مورد مکانیسم و سینتیک
 پلیمر شدن [۱۳]، اثر حلال روی پخت و خواص مکائیکی و سیستم
 حلالهای مختلف انجام شده است [۱۴-۱۶].

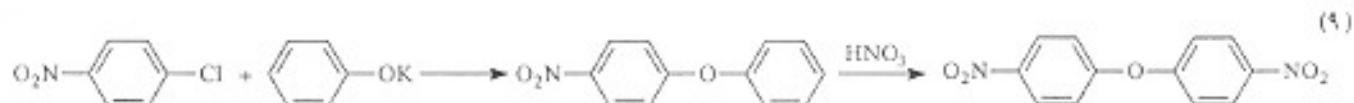
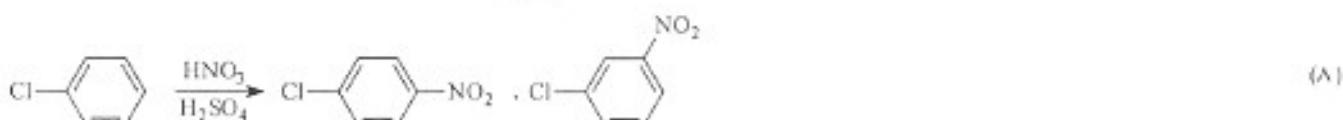
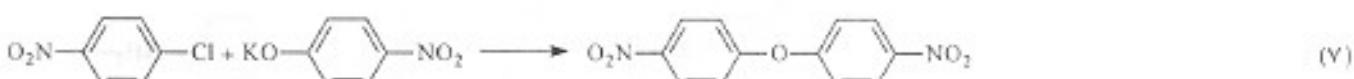
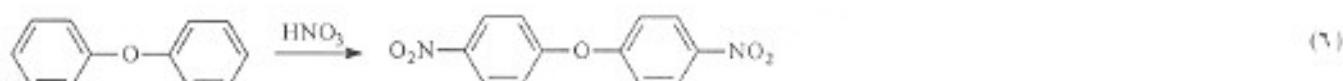
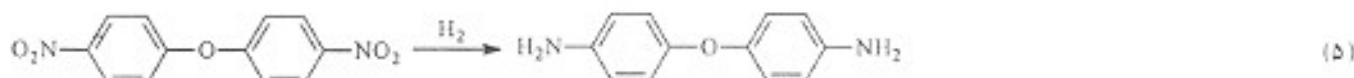
طبق معادله ۳ از گرمایدن پیروملیتیک اسید
 (PMA) با ساختار ۵،۶،۲،۱-بنزن تراکرکوبیلیک اسید تا ۲۰۰°C
 در بی فلیل کلریدها بدست می آید [۱۷]. برای تیهیه PMA روش های
 مختلف وجود دارد که چند روش مهم آن به قرار زیر است: اکسایش
 ۵،۴،۲،۱ تری متیل پترن، اکسایش در فاز مایع به کمک پتاسیم
 پر منگنات [۱۸-۲۰]، اکسایش کلک با نیترویک اسید که در این روش
 محلولی از اسیدهای مختلف بدست می آید و می توان با جداسازی به
 پیروملیتیک اسید رسید [۲۱، ۲۲]، اکسایش لیگنین [۲۲]، اکسایش
 زغال [۲۴، ۲۵]، کلرو متیل دار کردن سودوکومن (سودوکومن از آنکل دار
 کردن زایلن بدست می آید) [۲۶]، هیدروزون دار کردن و اکسایش
 آنرا من در فشار زیاد [۲۷]، استیل دار کردن زایلن و اکسایش آن [۲۸].
 در این پژوهش روش کلرو متیل دار کردن زایلن [۲۹]، ترجیحاً
 متازایلن، بکار گرفته شده است. اکسایش به کمک
 نیترویک اسید و پتاسیم پر منگنات انجام می گیرد. مزیت این روش نسبت
 به سایر روشها، مواد اولیه ارزان قیمت است. واکنش گر اصلی این واکنش
 بیس کلرو متیل اتر (ClCH₂OCH₂Cl) است که به جای این واکنش
 می توان از محلول کلریدریک اسید و فرمالدهید نیز استفاده کرد. در این
 واکنش محصول مونو کلر و متیل متازایلن هم بدست می آید که در فاز
 مایع است. بنابراین، اکسایش در فاز مایع منجر به تشکیل تری ملیتیک
 اسید می شود (معادله ۴).

۴- دی نیترو دی فلیل اتر بدست می آید
 (معادله ۵). این ترکیب از سه روش زیر ستر می شود:

۱- نیترودار کردن دی فلیل اتر از واکنش
 کلروپترن و پتاسیم فوکسید تحت فشار بدست می آید.

۲- واکنش پارا نیترو کلروپترن با پارا نیترو پتاسیم فوکسید که همان
 ستر ویلیامسون است (معادله ۷). در این روش، بعلت الکترو کلندگی
 گروه نیترو، قدرت هسته دوستی پارا نیترو سدیم فوکسید کاهش می پابد و





سترن ۶،۴ - بیس(کلرومتیل) متازایلن
به یک بالن دو دهانه مجهز به دما ساعت و میرد مقدار ۱۱/۵ mL به یک بالن دو دهانه مجهز به دما ساعت و میرد مقدار ۱۱/۵ mL معادل ۵ g (۰/۰۹۴ mol) متازایلن، ۱۸/۲ mL (۲۰ g) محلول فرمالدید ۷/۷ - ۲۲ درصد، ۳۲/۶ mL (۴۰ g) کلرید ریک اسید ۳۷ درصد اضافه می شود و مدت ۶ ساعت با همزدن شدید تا دمای $^{\circ}\text{C}$ ۷۰ - ۷۵ رفلاکس می شود و پس از ۱۸ ساعت دیگر تا دمای $^{\circ}\text{C}$ ۷۰ رفلاکس می شود. ابتدا، محلول کدربی بدست می آید که پس از سرد شدن دوفازی شده و رسوب سفید روغنی شکل بلوری حاصل می شود. پس از شستشوی رسوب با آب، این ماده با هگزان خالص سازی و با سولفات متیزیم خشک می شود حاصل این واکنش ۶،۴ - بیس(کلرومتیل) متازایلن با بارده ۶۶ درصد است. طیف IR و H NMR سترن این ماده را تایید می کند. دمای ذوب محصول بدست آمده $^{\circ}\text{C}$ ۹۲ است [۳۱،۳۶].

واکنش اکسایش

اکسایش این ماده طی دو مرحله با نیتریک اسید انجام می شود. در مرحله اول با استفاده از نیتریک اسید ۴۷ - ۴۸ درصد و ورود اکسیژن در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۱۱ - ۱۰۵ واکنش انجام می گیرد. رسوب بدست آمده طی واکنش کلرومتیل دار شدن با ۱۰ برابر وزنی نیتریک اسید ۴۳ درصد و ورود

PMDA از ODA بتدريج به آن اضافه و بعد از مدت ۲ تا ۳ دقيقه دیگر حل شد. پس از حل شدن PMDA و گذشت ۲۴ ساعت (مدت زمان پلimer شدن) محلول ليموري رنگ PAA بدست می آيد که طيف IR سترن اين ماده را تاييد مي كند. با اين روش محلولي بدست می آيد که دراي ۲۰ درصد وزنی از پلimer تولد است و بدون هيج مشکلي همزده می شود. PAA تهيه شده با اين روش در ۵/۰ درصد متيل فرامايد در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۲۵ داراي گرانروي ذاتي η_{inh} $2/1$ است. برای خالص سازی از DMF استفاده می شود [۴،۸].

نهيد فilm پلي آسيك اسید روی سبعه ششه اي خشک با اپليکاتور $800 \text{~m}\mu\text{m}$ فيلمني از پلي آسيك اسید كشide می شود و برای ۴۰ دقيقه در آون حلاه در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۸۰ قرار گرفت [۴،۸].

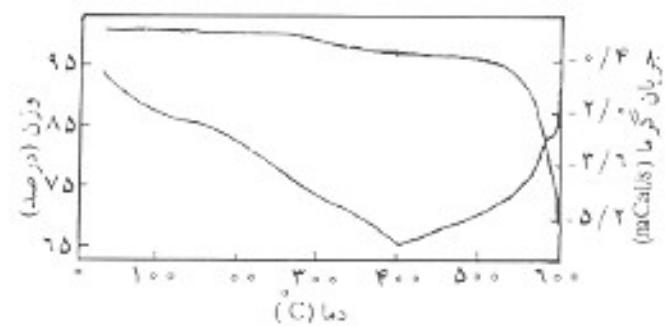
نهيد پلي ايميد (PI) به سرعت $3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ با $^{\circ}\text{C}$ ۲۰ تا دمای $^{\circ}\text{C}$ ۲۰۰ گرماداده می شود و پس، مدت ۲ ساعت در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۲۲۰ قرار می گيرد. طيف IR سترن اين ماده را تاييد مي كند.

۹۵٪ مس فعال شده (مس برتر در این واکنش باعث بارزه کم می شود اما به وسیله محلول ۲ درصد استون یا کلریدریک اسید فعال می شود [۲۶]) به عنوان کاتالیزور بکار برده می شود و ۷/۸۸ mol (۰/۰۵٪) پاراپتروکلورو بنزن به آن اضافه می گردد، بالن تاریخ دن به دمای 130°C - 140°C گرم می شود. در این دما محتویات بالن شروع به جوشیدن می کند که باید گرمادهی در این مرحله قطع شود. ۵ تا ۷ دقیقه پس از به جوش آمدن محتویات بالن، ۷/۸۸ mol (۰/۰۵٪) دیتک پاراپتروکلورو بنزن به آن اضافه می گردد [۲۳]. پاراکلرونیتروودی فنیل اتر را روی فیل بوخر صاف و با آب شته می شود. پس از خشک شدن در هوا، محصول با تقطیر در دمای 180°C و خلاء 220 mmHg IR و H NMR و STIR اکسایش را تایید می کند [۲۴].

نتایج و بحث

DSC-TG گروه‌گاشت

نمودار DSC-TG برای نمونه‌ای از PMA نهیه شده که قبل از مدت دو ساعت در دمای 20°C گرمادیده است (شکل ۱). سرعت گرمادهی $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ از 20°C تا 25°C است. نمودار اول مربوط به آزمون TG است که برای بررسی تجزیه گرمابی در جو انجام شده است. همان‌طور که



شکل ۱- گروه‌گاشت DSC-TG ترکیب PI

اکسایش تا دمای 110°C ۱۰۵٪ به مدت دو ساعت و سیم رفلکس می شود. از این مرحله، رسوب سفید نامحلولی بدست می آید که طبقهای IR و H NMR مربوط به این ماده پیشرفت واکنش اکسایش را شان می دهد [۲۵].

در مرحله دوم با استفاده از تیتریک اسید ۳۰ درصد، فشار atm و دمای 170°C این ماده بطور کامل اکسید می شود و PMDA بدست می آید. این مرحله در راکتور تحت فشار با پوشش شیشه باید انجام شود که به علت عدم دسترسی به راکتور از آن صرقت نظر شد. برای اکسایش این ماده از پتانسیم پر منگنات استفاده می شود [۲۶]. پس از افزودن کلریدریک اسید غلیظ رسوب سفیدرنگی بدست می آید که صاف می شود.

سترن پاراکلرونیتروبنزن

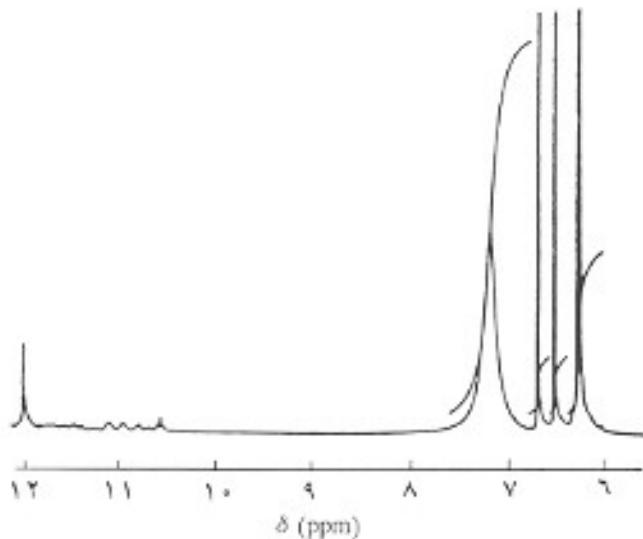
۴۰ mL سولفوریک اسید غلیظ به بالن حاوی 40 mL نیتریک اسید غلیظ بتدربیح اضافه می شود. مخلوط این بالن خوب همزده می شود و در آب سرد قرار می گیرد و پس از آن در 4°C نوبت 20 mL کلروبنزن 19°C درصد بتدربیح به آن اضافه می شود [۲۶]. پس از صاف کردن محصول با کل دوساره تقطیر شده و رفلکس و خالص سازی می شود. محصول این مرحله دارای رسوب سوزنی شکل پاراکلرونیتروبنزن است که پس از سرد شدن صاف می شود. مایع زیر صافی حاوی ارتوکلرونیتروبنزن و مقدار کمی پاراکلرونیتروبنزن است. دمای ذوب رسوب سوزنی شکل برای 82°C - 84°C بدست می آید. بازده واکنش ۶ درصد است و طیف IR و بزرگیهای این ماده را شان می دهد [۲۶].

سترن پاراپترودی فنیل اتر

۸ g فنول با خلوص ۹۹ درصد و 8 g (۰/۰ مول) پتانسیم هیدروکسید به یک بالن ۳ دهانه مجهز به دماستن و میرد منتقل می شود و تاریخ دن به دمای 130°C - 140°C گرم می شود تا پتانسیم هیدروکسید حل شود. پس از آن مخلوط تا دمای 110°C - 100°C گرد و

چکشیده شود.

سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی ۱۳۷۹

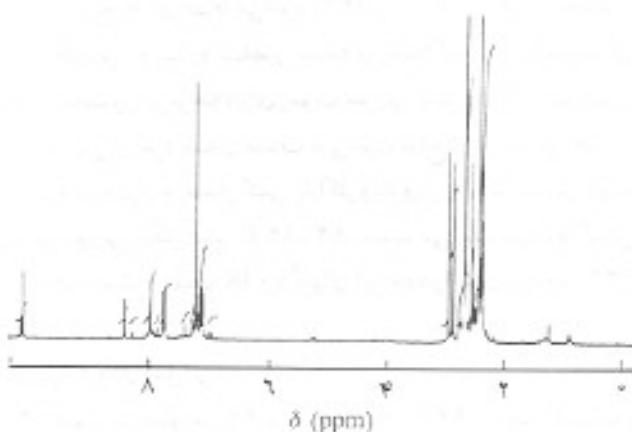


شکل ۲- طیف H NMR پلی آمیک اسیدی که دو ساعت در دمای 80°C قرار گرفته است.

اصلی مطابقت دارد، در این طیف، همان طور که انتظار می‌رود ارتعاش کششی مربوط به گروه آمیدی در ناحیه 1666 cm^{-1} (در مرجع Δ)^۸ و 1661 cm^{-1} (باشدت قوی و نوار ارتعاش کششی C=O آمیدی در ناحیه 1715 cm^{-1} (در مرجع Δ)^۸ و 1711 cm^{-1} (باشدت کم به صورت شاهای مشاهده می‌شود، در طیف فیلم PAA که به مدت ۲۰ دقیقه در دمای 80°C قرار گرفته است، علاوه بر تغییر کاهش نوار جذبی O-H ، پیک در ناحیه 1715 cm^{-1} تیز مشخصتر مشاهده می‌شود، در طیف IR پلی ایمید نوار جذبی قوی آمیدی در ناحیه 1666 cm^{-1} مربوط به گروه آمیدی PAA حذف و نوار جذبی قوی آمیدی در ناحیه 1718 cm^{-1} و شاهای در 1778 cm^{-1} (در مرجع Δ)^۸ و 1718 cm^{-1} (۱۷۷۸ cm^{-1}) مشاهده می‌شود که مربوط به ارتعاش کششی متقارن C=O گروه PI است. علاوه بر این نوار جذبی در ناحیه 755 cm^{-1} (در مرجع Δ)^۸ و 757 cm^{-1} (۷۵۷ cm^{-1}) به ارتعاش خمشی حلقه ایمید نسبت داده می‌شود و این دلیل دیگری بر انجام ایمیدی شدن و تشکیل PI است.

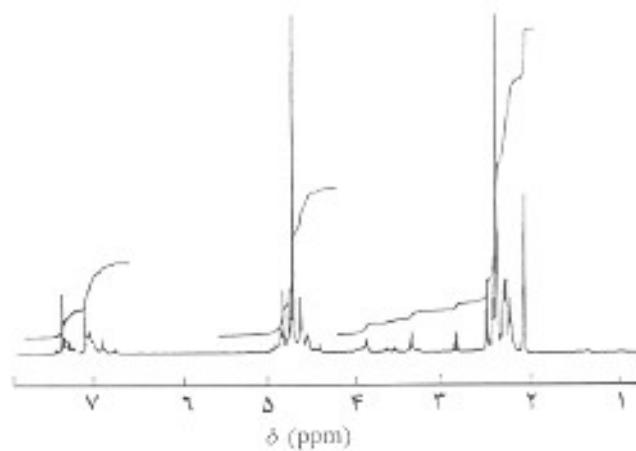
طیف IR توکیب 6.4 -پیس (کلرومتیل) متازایلن در طیف IR این ماده، نوار جذبی در ناحیه 2900 cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیافایک مشاهده می‌شود. گروه C=C حلقة آروماتیک در ناحیه 1650 و 1550 cm^{-1} دارای جذبی متوسط است. نوار جذبی در ناحیه 1375 cm^{-1} وجود گروه متیل راشان می‌دهد. ارتعاش خمشی CH_3 در ناحیه 1450 cm^{-1} نوار جذبی باشدت متوسط راشان می‌دهد. نوار جذبی باشدت قوی در ناحیه 650 cm^{-1} مربوط به جذب گروه C-Cl است.

طیف H NMR توکیب 6.4 -پیس (کلرومتیل) متازایلن این طیف (شکل ۳) با دستگاه 300 MHz ${}^1\text{H}$ NMR δ برای نمونه جامد در توکیب 6.4 -پیس (کلرومتیل) متازایلن



شکل ۳. طیف ${}^1\text{H}$ NMR حاصل از اکسایش مرحله اول 6.4 -پیس (کلرومتیل) متازایلن.

مجله علمی کوثر پژوهی سال سیزدهم، شماره اول، بهار ۱۳۷۹



شکل ۲- طیف ${}^1\text{H}$ NMR توکیب 6.4 -پیس (کلرومتیل) متازایلن.

مشاهده می‌شود C=O افت وزنی محسوسی دیده نمی‌شود و تا دمای 60°C حدود 7% درصد وزنی نمونه دستخوش تخریب شده است. نمودار دوم مربوط به آزمون DSC است که برای اندازه گیری دمای انتقال شیشه‌ای در جو گاز اکسیژن انجام شده است. همان طور که در سودار مشخص است، T_g آن بطور مشخص حدود 20°C قرار دارد.

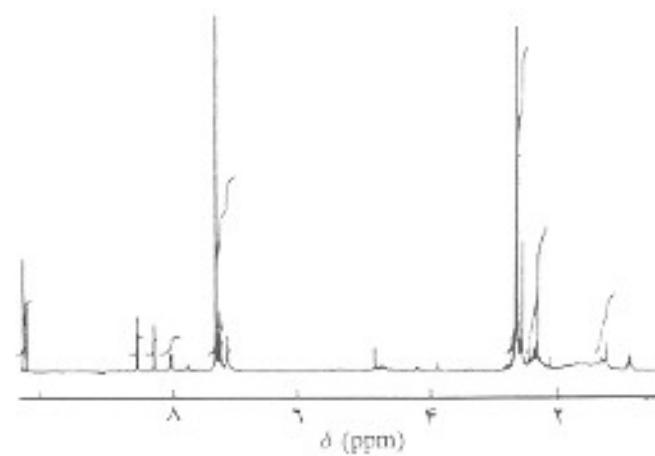
طیف ${}^1\text{H}$ NMR پلی آمیک اسید این طیف با دستگاه 300 MHz ${}^1\text{H}$ NMR δ برای نمونه جامد حل شده در DMSO دوتریم دار برداشت شده است، این نمونه به مدت دو ساعت در دمای 80°C قرار گرفته است.

پرسونهای بسترنی بخش آمینی در جایه‌جایی شیمیابی $7/25\text{ ppm}$ با مساحت نسبی $8/6$ روزناتس می‌کند (شکل ۴). در این پیش‌بیان نش هیدروژن در بخش آسیدی وجود دارد که دو هیدروژن مربوط به ایزومر سیس، دو هیدروژن به ایزومر ترانس و دو هیدروژن دیگر مربوط به پیرفت ایمیدی شدن است.

سه پروتون (H_3 - 2H_3) (۳) با جایه‌جایی شیمیابی $7/452\text{ ppm}$ و مساحت نسبی $3/2$ در یک موقعیت روزناتس می‌کند. سه پروتون دیگر (H_3 - 11H_3 - 11H_3) در جایه‌جایی شیمیابی $7/61\text{ ppm}$ با مساحت نسبی $12/3$ جذب «ارند»، یک در جایه‌جایی شیمیابی 12 ppm با مساحت نسبی $19/284$ روزناتس هیدروژن آمیدی راشان می‌دهد و در نهایت در جایه‌جایی شیمیابی $12/7\text{ ppm}$ هیدروژن آمیدی را مساحت نسبی 1 روزناتس می‌کند (۴)، همان طور که این طیف نشان می‌دهد تعداد هیدروژنها با مساحت‌های نسبی آنها کاملاً هماهنگی دارد.

طیف IR پلی ایمید طیف IR پلی ایمید در مقایسه با طیف آمده در مرجع 8 از نظر عاملهای

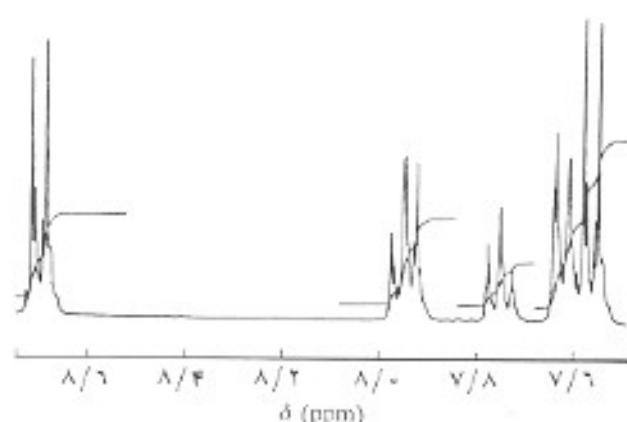
موقوعت مشابه در جایه جایی شیمیایی ۵/۷ ppm با سطح نسبی ۱/۹۸ تر دیگر به هم رزونانس می‌کند. یک مربوط به پروتون H₂ در جایه جایی شیمیایی ۷/۷ ppm با انگرال ۵/۵، مشاهده می‌شود. پروتونهای H₃ به علت قرار گرفتن در کنار اتم الکترونگاتیو اکسیژن و اثر الفای منفی آن در میدان پایانی در جایه جایی شیمیایی ۷/۹۱ ppm با سطح نسبی ۱/۰۲ رزونانس می‌کند. جذب H₄ به دلیل قرار گرفتن در مجاورت گروه الکترون کشیده نیترو در جایه جایی شیمیایی ۸/۶۸ ppm و با سطح نسبی ۹/۹۸۲، مشاهده می‌شود. لبت انگرالها دفیقاً مناسب با تعداد هیدروژنهای پاراپترودی فنیل از است.



شکل ۵- طیف NMR H حاصل از اکسایش مرحله دوم - بیس (کلرومتیل) متازایلن با پتانسیم پرمغناط.

نتیجه گیری

پلی آمیک اسید حاصل از کopolymer شدن ODA و PMDA به رطوبت حساس است، از این رو پلیمر شدن در جوی از پتروزن و در حالی که قلاً خشک شده انجام می‌شود، بهترین نتایج پلیمر شدن در دمای ۱۵-۲۵°C بدست می‌آید. بالای ۷۵°C وزن مولکولی پلی آمیک اسید کاهش می‌باشد. پیشتر از ۱۰۰°C حلقه سازی ایجاد شروع می‌شود و تبدیل بالای ۹۰ درصد در دمای بالای ۲۲۰°C صورت می‌گیرد. پلی ایمید حاصل تا ۶۰۰°C پایداری گرمایی دارد.^{۶,۷} بیس (کلرومتیل) متازایلن با جایگزینی گروه کلرومتیل Cl-CH₂-Cl به جای هیدروژن متازایلن با استفاده از کلریدریک اسید غلیظ و محلول فرمالدهید بدست می‌آید. آنچه در این واکنش مهم است، نسبت وزنی کلریدریک اسید و محلول فرمالدهید به زایلن است که حدود ۴-۵ برابر است. در اکسایش با نیتریک اسید نتایج طیف سنجی H NMR حذف گروه کلرومتیل را نشان می‌دهد. در اکسایش با پتانسیم پرمغناط یکهای مربوط به گروه متیل به سمت میدانهای ضعیفتر جایه جای می‌شود



شکل ۶- طیف NMR H پاراپترودی فنیل ان.

حل شده در استون دوتریم دار گرفته شده است. اولین سطح نسبی ۵/۲ است که مربوط به متیلهاست. دوین سطح نسبی ۵/۱ مربوط به گروه کلرومتیل است. سوین و چهارین سطح نسبی برای هر هیدروژن ۱/۲ است.

طیف NMR H محصول اکسایش مرحله اول و مرحله دوم - بیس (کلرومتیل) متازایلن

این طیف با استفاده از حلایل کلروفرم دوتریم دار گرفته شده است. شکل ۳ طیف ۱H NMR ۱۱ ترکیب - ۶,۷- بیس (کلرومتیل) متازایلن را قبل از اکسایش نشان می‌دهد. اکسایش سونه با استفاده از نیتریک اسید ۴۲ درصد، وزود هوا و چگرماده نایدامای ۱۱۰°C به مدت دو ساعت احجام شده است. همان طور که انتظار می‌رود، یکهای پروتونهای گروه کلرومتیل حذف و به سمت میدانهای پایینتر جایه جای شود، بنابراین یکهای در جایه جایی شیمیایی ۲-۳ ppm دیده نمی‌شود (شکل ۴). در ضمن، قدرت اکسید کنندگی نیتریک اسید در حدی نیست که بتواند هیدروژنهای متیل را اکسید کنند، بنابراین هیدروژنهای متیل دست نخورده باقی می‌ماند. وجود یکهای در جایه جایی شیمیایی ۵ ppm ۱۰/۲۶ دلیل دیگری بر پیشرفت اکسایش این ماده است. شکل ۵ طیف ۱H NMR محصول اکسایش با پتانسیم پرمغناط است.

طیف NMR H پاراپترودی فنیل ان
این طیف (شکل ۶) برای نموده جامد حل شده در استون دوتریم دار گرفته شده است.

طیف رزونانس معنایتسی هسته پاراپترودی فنیل اتر وجود ۵ نوع هیدروژن را تایید می‌کند. پروتونهای H₁ و H₂ به علت داشتن

14. Chiten T.Z.U., Hsu J. and Ling Z.; *J. Appl. Polym. Sci.*; **46**, 1821-33, 1992.
15. Chien T. and Shsu L. Z.; *Macromolecules*; **28**, 9000-1, 1996.
16. Kevin G., Suzuki H. and Mitsutoshi J.; *Polym. J.*; **29**, 3, 290-2, 1997.
17. Katsuyama Y.; horie, toshio Yoshida Kazuaki Japan Kokai, 73, 13, 336, feb. 1973.
18. Mitsubishi Edogawa Chemical Co.; Fr. Pat. 1,155,135; 24 June, 1969.
19. Akhmetov A.G. et al.; *Nefkhimiya (Russ.)*; **10**, 6, 879-82, 1970.
20. Nakayama T. et al.; Jap. Pat. 7,336,142; 8 May. 1970.
21. Directic van de Staatsmijnen, Ger. Pat.; **71**, 078; Oct. 1952.
22. Goedkeep M.L.; U.S. Pat. 2,640,075; 26 May, 1953.
23. Kleinnickel O.; Ger. Pat. 1,006,412; 18 April, 1957.
24. Germain J.E. and Valadone F.; *Bull. Soc. Chim. France*; 1415-17, 1958.
25. Germain J.E. and Delatire P.; Fr. Pat. 1,324,368; 19 April, 1963.
26. Pavelko N.V. et al.; *Technol. Inst. (Russ.)*; **27**, 70-7, 1971.
27. Juergen S. and Georg K.; US.Pat.3,350,443; 31 Oct., 1967.
28. Barkov S.M.; USSR. Pat. 230,127; 30 Oct., 1968.
29. Technik GmbH; Br. Pat. 771,086; 27 March, 1957.
30. Hoff M.C., Standard Oil Co.; US.Pat.2,873,584; 3 June, 1958.
31. Earhart H. W. and Nicholson D. E.; US. Pat. 3,031,513; 24 April, 1962.
32. Towle J.L.; US. Pat. 3,140,316; 7 July, 1964.
33. Bam Kole T.O.; *J. Chem. Soc. Perkin Trans.*; **2**, 2114, 1923 and *Org. Synth. Coll.*; **2**, 445-7, 1920.
34. Stozhkova G.A. et al.; *USSR. Ush. Zap. Yardslav. Tekhnol. Inst. (Russ.)*; **11**, 185-92, 1969.
35. US. Pat. 2,942,994; 28 June, 1960 and US. Pat. 3,140,316, 7 July, 1964.
36. *Vogel Textbook of Practical Organic Chemistry*; Longman, London and New York, 19976.
37. *Aldrich Library of Infrared Spectra*; 3rd. ed., Aldrich Chemical, 1981.

که حاکم از پیشرفت اکسایش است. در نیترودار کردن کلروبنزن چون واکنش شدید و گرماده است کنترل دما پسپار مهم است. در مرحله اندایی، گرماده موجب خروج گاز خرمایی NO_2 می شود و با توجه به قدرت هدایت کنندگی ارتو و پارای کلر، استخلاف بعدی می تواند در هر دو موقعیت قرار گیرد. از این رو، برای جداسازی از الکل استفاده می شود. در مرحله ستر آریل اتر کاتالیزور من قعال شده بکار می رود تا برای این واکنش مناسب باشد. در ضمن، اگر ماده اولیه ارتوکلرو نیترو بنزن باشد بهمین روش ارائه شده از نیترودار فنیل اتر رانیز می توان بدست آورد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاران در آزمایشگاه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و آزمایشگاه H NMR علوم و تحقیقات و گروههای آزمایشگاه پلی بورتان و آرایز پژوهشگاه پلیمر ایران قدردانی می شود.

مراجع

1. Critchley J.P., Knight G.J. and Wright W. W.; *Heat Resistant Polymers*; Plenum, New York, USA, 1983.
2. Stenzenberg H.D. and Hergenrother P.M.; *Aromatic Polyimide*; Chapman & Hall, New York, USA, 1990.
3. Brydson J.A.; *Plastic Chemistry*; Kai Sa, New York, USA, 1965.
4. Sroog C.E. et al.; *J. Polym. Sci.*; **A3**, 1373-91, 1965.
5. E.I. Dupont de Nemours; Fr. Pat. 1,239,491; 1960.
6. Adrova N.A., Koton M.M., Moskvina E.M. and Akad D.; *Nauk USSR (Engl. Trans.)*; **165**, 5, 117, 1965.
7. Bower G.M. and Frost L.; *J. Polym. Sci.*; **A1**, 3135, 1963.
8. Sandler S. R.; *Polymer Synthesis*; Central Research Laboratory, Borden Chemical Company, Pennsylvania, USA, 1960.
9. Echigo Y., Isao T. Y. and Yamada H.; *Macromolecules*; **28**, 4861-65, 1995.
10. Inaike I. H.; Vbe Industries, 38th International Wire and Cable Symposium, Georgia, USA, 111-9, 14-16 Nov., 1989.
11. Anon; British Plastic; **41**, 69, Feb. 1968.
12. *Chromatog. J.*; **299**, 1, 139-49, 1984.
13. Grenier L., Joubert M.F. and Grenier F.; *J. Polym. Sci. Polymer Chemistry*; **29**, 11, 1646-60, 1991.